# 大気中マイクロギャップの絶縁破壊特性

# 山野 芳昭\*,1 (2012年1月23日受付; 2012年3月11日受理)

# Characteristics of Breakdown between Electrodes with Micro-gap in Atmosphere Yoshiaki YAMANO<sup>\*,1</sup>

(Received January 23, 2012, Accepted March 11, 2012)

Breakdown characteristics in atmosphere were studied using knife-edge and plane electrodes with a gap distance (*d*) ranged from 0.5µm to 20µm. Materials of the knife-edge electrode and plane electrode were steel and Au evaporated film on an aluminum disk, respectively. The gap distance was controlled by the piezo-actuator with a 20 nm step. The kinds of applied voltages to the electrode system were dc, ac and impulse (Imp). It was experimentally found out that breakdown voltage (BDV) kept almost the constant value even when the gap distance was changed in the area 0.5 µm  $\leq d \leq 3$  µm. In the case of the distance d > 3 µm, the breakdown voltages increased with an increase in the distance. These tendencies were observed in all the kind of applied voltage studied. When the material of the plane electrode was changed to Au evaporated film on PMMA board, DCBDV in that area of *d* decreased with the decrease in the gap distance. However, in the case of impulse voltage application, ImpBVDs in that area of *d* kept the constant value as those using the Au evaporated film electrode. It was suggested that the constant BDV in that area results from the Townsend discharge mechanism where the electron avalanches appear. The decrease in BDV with the decrease in *d* appears only when the breakdown is triggered by melting or vaporizing of electrode material due to the current resulting from the electron field emission.

#### 1. はじめに

数μm以下の微小ギャップの絶縁破壊現象の解明は, MEMS (Micro Electro Mechanical System) における微細電 極の信頼性確保や静電気放電あるいは帯電電荷の除電の 機構解明にとって重要な課題の一つである. 大気中の絶縁 破壊電圧特性については、Paschen の法則<sup>1)</sup>が一般的によ く知られている.この法則はTownsend型放電機構を基礎 としており, そこでは電子による衝突電離, 電子なだれ, そして陰極の二次電子放出などが重要なファクターとな っている. Paschen の法則によると、大気中の平等電界に おける絶縁破壊電圧 (BDV) はあるギャップ長 (d<sub>Pmin</sub>) に おいて、最低値(V<sub>Pmin</sub>)存在することが知られている.大 気中におけるV<sub>Pmin</sub> とそれが現れるd<sub>Pmin</sub> は, 測定者によっ て多少異なるが、それぞれおおよそ 330-360 V と5-7 μm である(ただしこれ以後,本論文では特に断りのない限 り,  $V_{Pmin}$ = 330 V,  $d_{Pmin}$ = 6  $\mu$ mとして取り扱う) . ギャッ プ長(d) が d<sub>Pmin</sub> より短い領域では、ギャップ中に存在す

**キーワード**:大気中絶縁破壊,微小ギャップ,パッシ エン則,電界放出

\* 千葉大学 教育学部(263-8522 千葉市稲毛区弥生町 1-33)

Faculty of Education, Chiba University, 1–33 Yayoicho Inage-ku Chiba-shi 263–8522 Japan

<sup>1</sup> yamano@faculty.chiba-u.jp

る初期電子の存在確率がきわめて少ない. さらには, 大気 中の電子の平均自由行程は約350 nmであるので<sup>2)</sup>, ギャッ プ中で電子なだれが発生する確率がきわめて少なくなる. これらのことによって, Paschen の法則では,  $d < d_{Pmin}$  な るギャップ長の領域では, ギャップ長が短くなるとともに BDV は $V_{Pmin}$  より上昇すると考えられている.

一方, Schaffert は,  $d < d_{Pmin}$  なるギャップ長の領域で は電極からの電界放出電流による影響によって, d の減少 とともに BDV も低下することを述べている<sup>3)</sup>. 仮に 300 Vの電圧が d =1 µm の平等ギャップに印加されていた場 合, 電界強度は E=3×10<sup>8</sup> V/m となる. この電界強度は, 金属からの電子の電界放出に十分な値である4).もし印加 電圧の上昇とともに電界放出に基づく電流が増加すれば, V<sub>Pmin</sub> 以下の印加電圧において何らかの要因で持続放電 (電流の暴走状態)に移行することも考えられる. P.G. Slade とE.D. Tayler は、d < 6 µm の領域の絶縁破壊は、電 子なだれによる Townsend 型絶縁破壊機構ではなく, 真空 中の絶縁破壊と同様に,高密度の電界電子放出電流に基づ く局部的な電極金属の溶融・蒸発がトリガとなって誘発さ れることを、いくつかの報告を基に述べている5).本報告 では、この機構での絶縁破壊を Field emission 型絶縁破壊 と呼ぶことにする. 最近では、MEMS等における導体間の 絶縁に関連して, Field emission 型絶縁破壊について多数 の検討結果が報告されている<sup>3, 5-13)</sup>. その中には, 電界放 出電流により溶融あるいは気化が生じにくい材質で形成 した電極を用いると, *d* < *d*<sub>Pmin</sub> となるギャップ長の領域で あっても, Townsend 型絶縁破壊機構の特性を示すという 報告もある<sup>8)</sup>. しかし, これらの報告の中で行われている 実験の多くは絶縁基板上に作製された電極を用いている ため, 基本的には沿面絶縁破壊の特性を測定しているもの であり,空間の絶縁破壊特性そのものを測定したものでは ない. また, 電極形状を一定の状態に保ったまま, 印加電 圧波形の変化や電極材質の変化が絶縁破壊特性へどのよ うな影響を及ぼすかなど, 絶縁破壊の基本的な特性を十分 に把握するには至っていない.

このような観点から,本研究では主に*d* が *d*<sub>Pmin</sub> より短 い領域において,刃型-平板電極に直流電圧,交流電圧あ るいはインパルス電圧を印加したときの大気中絶縁破壊 特性について,*d* および平板電極の材質を変化させながら 検討を行った.

#### 2. 実験方法

### 2.1 電極

図1に使用した電極の形状並びに電極の構成を示す.電極 は刃型-平板構成である.二つの電極はそれぞれ微動台の上 に取り付けられている.ギャップ長(d)は、二つの微動台 を動かすことにより調整を行った.接地平板電極側の微動 台はピエゾアクテュエータによる駆動である(スライド量 の分解能は 20 nm).実験を行った電極間隔は 0.5  $\mu$ m  $\leq d \leq$ 20  $\mu$ m の範囲である.図1に示すように、刃型電極に高電 圧を印加した.電極先端の保護のため、電源と高電圧側電 極との間に 0.1 MΩの抵抗を挿入してある.

刃型電極(先端角≈10 deg.)の材質は鉄(Fe)である.平 板電極はハードディスクのアルミニウム製円板表面に金

(Au)を蒸着したものである.円板表面の凹凸は±10 nm 以 内にあることを AFM にて確認してある.また,電極材質の 変化による絶縁破壊電圧の影響を検討するため,PMMA 板

(凹凸は±75 nm) に Au を蒸着したものも用いた. ここでは、Au 蒸着したディスクを Au 蒸着 HDD 板、Au を蒸着した PMMA 板を Au 蒸着 PMMA 板と表記する.

図2は1分おきに10回連続して直流電圧を印加した時に 発生した放電光(絶縁破壊に起因したもの)を1枚の写真フ ィルムに多重撮影したものである.図に示すように,10回 の放電の発生が刃型電極の両端のエッジに集中することな く,電極全体にほぼ均一に発生している.また,放電光を撮 影したときの BDV のばらつきは平均値の3%の範囲内に収 まっている.これらのことから,刃形電極先端の加工の不均 一性が絶縁破壊の過程に影響を及ぼしていないものと考え



図1 電極の配置図

 $C_A$ : 刃型電極,  $C_E$ : 平板電極, B: PMMA 版,  $S_A$ : 微動 台,  $S_B$ : 微動台, d: ギャップ長.

Fig.1 Electrode setup.



- 図2 絶縁破壊の放電光(10回の多重露光)
- Fig. 2 Light due to breakdown (superimposed records of 10 times of breakdown).

られる.

#### 2.2 絶縁破壊電圧 (BDV)の測定

刃型電極に直流電圧,交流(50 Hz)電圧あるいはインパルス電圧を印加して, dを変化させながら BDVの測定を行った. 直流 BDV (DCBDV)の測定では,一定の上昇速度(10 V/s)にて印加電圧を上昇させ,絶縁破壊が発生した時の電圧の値を読みとった.同一条件の試料1セットについてこの操作を1min毎に10回繰り返し,読み取った電圧値を10セットすべてについて平均した値をDCBDVとした.交流 BDV (ACBDV)の測定は,DCBDVの測定と同じ手順で行った.本論文に示したACBDVの値は実効値である.

インパルス BDV (ImpBDV) の測定では, 1.2×10 μs の標 準インパルス波形<sup>14)</sup>の電圧をギャップに印加した.子め予 想される ImpBDV より 50 V 低いインパルス電圧を一発印加 する.そして,絶縁破壊が発生するまで,10 V ずつ印加電圧 を上昇させ,電圧の上昇ごとに一発ずつ電圧を印加した.同 一条件の試料 10 個について,絶縁破壊が生じたときの印加 電圧を平均して ImpBDV とした. なお、インパルス電圧の 値は波形の波高値で表す.

なお測定の結果, DCBDV, ACBDV および ImpBDV の測 定値のばらつき(分散)は, 平均値の 3%以内であった.

# 2.3 絶縁破壊前駆電流の測定

直流電圧印加において,絶縁破壊に至るまでの電流を測定 した.測定に際しては,図1において,平板電極と接地との 間に高感度電流計を挿入した.また,電流波形の観測に際し ては,電流検出用のインピーダンス(抵抗(1 kΩ)とコン デンサ(0.047 μF)の並列回路)を挿入して,その両端の電 圧波形を,増幅器を経由させてディジタルオシロスコープに て測定した.

#### 3. 結果と検討

#### 3.1 BVD とギャップ長との関係

図3(a), 図3(b)および図3(c)にそれぞれ直流,交流およ びインパルス電圧を印加したときのBDVとギャップ長(d) との関係を示す.これらの測定で使用した平板電極はすべ てのAu蒸着HDD板である.

図3の三つのグラフが示すように、いずれの印加電圧に おいても0.5  $\mu$ m  $\leq d \leq 3 \mu$ m の範囲では、 dの変化にかか わらず BDV が一定の値を示している. すなわち、実験に 用いた刃型-平板電極系で平板電極がAu 蒸着 HDD の場 合には、 $d < d_{Pmin}$ の領域でdの減少にともなって BDV が  $V_{Pmin}$  よりも低下する傾向<sup>3,5-13</sup>は観測されない.

一般的には、電極先端の電界が強く歪んでいると考えられる刃型電極に負電圧を印加すると、電極先端からの電子の電界放出等の影響によりBDV特性が正極性の場合と異なることが考えられる.しかし、測定したDCBDVと ImpBDVのいずれにおいても、負極性BDVの方が正極性よりも低い値を示しているが、dが短い領域では両者に大きな違いがない.そこで、本実験で測定を行ったdの範囲における電極先端近傍の電界を求め、その結果を基に、測定結果から得られた正極性BDVと負極性BDVに大きな違いが見られないことについて検討を行った.本実験で用いた刃型電極の先端は電極の断面写真で確認したところ、曲率半径は0.5 µm 程度であった.そこで半径0.5 µmの円と直線とで構成する2次元平面電極系における電界を等角写像法により求め<sup>15</sup>、それを本実験で用いた刃型一平板電極における電界の近似解とした.

図4に電界計算の結果を示す. 図中の Ep は円電極の先端の電界, En は電極と平板電極との距離が最短になる平板電極上の点における電界である. 図に示すように d < 2 µm の領域では, Ep と En の差はごくわずかである. 言い換えると,本実験で使用した刃型-平板電極系において d

が短くなると、刃型電極先端近傍の電界は、ほぼ平等電界 と見なすことができる.したがって、本実験における絶縁









破壊がどのような過程で生じるにしても,ほぼ平等電界に 近い電界の状況下では,図3(a)および図3(c)に示すよう に,BDVの印加電圧極性依存性は顕著には生じないこと になる.ただし,測定されたBDVのわずかな印加電圧極 性依存性の原因については電極材料の影響が考えられる が,現在のところまだ特定できるには至っていない.

#### 3.2 絶縁破壊に至るまでに流れる電流

多くの報告<sup>3,5-13)</sup>では,*d* < *d*<sub>Pmin</sub>のギャップ長の領域での BDV は *d* の減少とともに低下することが示されており, その原因は Field emission 型の放電がトリガとなって絶縁 破壊が発生しているためと結論づけている.しかし,本実 験の実験結果は,図3に示すように,これらの報告とは異 なり,BDV は *d* の減少とともに低下していない.そこで, 本実験の刃型-平板電極系の絶縁破壊に至るまでの過程 において,絶縁破壊前にギャップを流れる電流について検 討を行った.

図 5 は直流電圧を絶縁破壊電圧測定時と同様に 10 V/s で上昇させたときに電極間に流れる電流を示したもので ある.  $d = 0.6 \mu m$  と  $d = 5 \mu m$  での波形は  $d \le d_{Pmin}$  となる dの領域における代表例であり d=10 µm および d=50 µm の 波形は d > d<sub>Pmin</sub> となる d の領域での波形である. d=50 μm の波形はBDVを測定したdの範囲を外れるものであるが, 参考として載せたものである. 図中に BD と記してあると ころで絶縁破壊が発生している. d < d<sub>Pmin</sub>のギャップ長の 領域では、図 5(a)、図 5(b)に示すように、絶縁破壊が発生 する前に直流電流が流れている. d=0.6 µm の場合には2 ×10<sup>-7</sup> A 程度の電流が流れている. d が長くなるにともな って, 直流電流は少なくなり, d=10 μm ではほとんど観 測されなくなる. 一方, d =50 μm の波形は, 絶縁破壊に 至るまでにパルス状の電流が多数発生している.これは部 分放電の発生に起因するものと考えられる.印加電圧が上 昇して,発生する部分放電の伸びがある長さまで達すると,



図5 直流課電において絶縁破壊前に流れる電流



ギャップを短絡して絶縁破壊に至る.  $d = 10 \mu m$  の時にパルス状電流が観測されないのは、 $d = 50 \mu m$  の時よりもギャップ長が短いので部分放電の発生と同時に放電がギャップを橋渡しするためと考えられる.

図4の電界計算結果から、d=0.6 µm における絶縁破壊 電圧(約330 V) 直前での電極先端の電界強度は10<sup>8</sup> V/m 以上になっている.この電界強度は電極先端からの電子の 電界放出に十分な値である<sup>3,4)</sup>.図6はBDV以下の印加 電圧においてギャップに流れる電流一印加電界特性を, Folwer-Nordheim Plot<sup>3)</sup>で示したものである.図のデータか らわかるように、測定プロットはほぼ直線で近似できる. すなわち、ギャップを流れる電流は電極から電界放出され た電子に基づくものであると考えられる.このようなこと から図5(a)の波形の直流成分の電流も電界放出された電 子に基づくものであることが考えられる.

### 3.3 平板電極の材質の変化と BDV との関係

図 5 と図 6 に示されたように、本実験に用いた刃型-平板電極においても、*d* < *d*<sub>Pmin</sub>のギャップ長の領域で、field emission に起因する電流が流れることは確認された.しか し、その電流に起因して電極が溶融し、微小アークが発生 して、*V*<sub>Pmin</sub> 以下の電圧で絶縁破壊が発生するには至って いない.もし電極を熱に対して溶融しやすいものに替えれ ば、真空中における絶縁破壊と同様に<sup>16</sup>,金属溶融微小ア ークによる絶縁破壊が発生する可能性が考えられる.そこ で、本実験で用いた平板電極(陽極)を Au 蒸着 PMMA 板に替えて BDV の測定を行った. PMMA 上の蒸着金属の 厚さは約 0.5 μm である.刃型電極から放出された電子電 流が薄い Au 蒸着膜を流れるので、電流密度が高くなり、 電流によるジュール熱が Au 蒸着 HDD 板よりも多く発生 する.したがって、電極表面の温度の上昇は Au 蒸着 PMMA 板の方がはるかに大きいはずである.



図 6 ギャップを流れる電流の Folwer-Nordheim プロット Fig.6 Folwer-Nordheim Plot for current through the gap.

図7にAu蒸着PMMA板の平板電極を使用したときの BDVとギャップ長(d)との関係を示す.図7(a)はDCBDV 特性であり,図7(b)はImpBDV特性である. 直流電圧を ギャップに印加すると、この電極の場合には、d <1.5 μm の領域でd が短くなるにしたがって, DCBDV の低下が見 られる(図7(a)).この特性は、微小ギャップの絶縁破壊 電圧を検討した多数の報告例に見られる BDV 特性と同じ 傾向である<sup>3,5-13)</sup>.一方,Au 蒸着 HDD 板を使用した場合 は,図 3(a) に示すように,BDV の低下は観測されない. 図7の結果から、Au 蒸着 PMMA 板を陽極平板電極とし て使用した場合は、V<sub>Pmin</sub>より低い印加電圧であっても、 刃型電極から電界放出した電子に基づく電流が熱容量の 小さい PMMA 上の Au 蒸着電極を溶融・蒸発させること によって微小アークが発生し、ギャップが短絡するものと 考えられる. したがって, DCBDV が V<sub>Pmin</sub> よりも低い値 となるものと考えられる 3,5-13).

もし電界放出に基づく電流に起因して生じる電極金属 の溶融・蒸発が BDV 特性に大きな変化をもたらすのであ れば,電圧印加時間が極めて短いインパルス電圧をギャッ プに印加した場合には, Au 蒸着 PMMA 板の平板電極で あっても電極の温度が上昇せずに, ImpBDV は V<sub>Pmin</sub>より



図 7 平板電極を Au 蒸着 PMMA 板に替えたときの BDV 特性 ((a)DC BDV, (b) ImpBDV)

Fig.7 BDV characteristics after the anodic plane electrodes is changed into Au evaporated film on PMMA board. ((a)DC BDV, (b) ImpBDV). 低い値にはならないことも考えられる.このような仮定の もとに図 7(a)で使用した電極と同じものを用いて ImpBDV の測定を行った.その結果が図 7(b)である. ImpBDV の場合はDCBDV で見られるような*d*<1.5 μm で の BDV の低下は観測されない.すなわち, PMMA 表面上 の Au 蒸着電極を使用した場合に,印加電圧波形の違い(電 圧印加時間の違い)によって生じた BDV 特性の大きな変 化は,電極の溶融が絶縁破壊のトリガとなっているか否か の違いによって現れたものと考えられる.

#### 3.4 0.5 µm ≤ d ≤ 3 µm の領域の絶縁破壊機構

Au 蒸着 HDD 板の平板電極を用いた場合,図3に示し たように、 $0.5 \mu m \le d \le 3 \mu m$  の領域では、DCBDV はdの 変化に関わらずほぼ一定の値を維持する.前項で示したよ うに、このギャップ長の領域の絶縁破壊は、熱容量の大き な電極を用いると、field emission の顕著な影響による DCBDV の低下が生じにくい.しかし、DCBDV の低下に 至らないまでも、field emission による電流に起因した電 極の溶融・蒸発をトリガとした絶縁破壊が生じている可能 性も考えられる.field emission に起因した電流(*I*)は、 Fowler-Nordheim の式<sup>15)</sup>によると、(1)式に示すように電 界強度(*E*)に大きく依存している.つまり、電極の溶融 も電界強度に依存していることになる.

 $I = (a/\varphi)E^{2} \exp(-b \varphi^{3/2}/E)$ (1)

ただし、a,bは定数、のは金属の仕事関数.

もし電極の溶融がある一定の電界強度で生じるとする と,*d* が短くなるとともにDCBDVは低下するはずである. ところが,測定されたDCBDVは*d* に関わらずほぼ一定の 値を示す.したがって,この*d* の領域の絶縁破壊が,Field emission 型であるとは考えにくい.

もし絶縁破壊が Townsend 型であるとすると, Paschen の法則<sup>1,2)</sup>により $d < d_{Pmin}$ のギャップ長の範囲の BDV は  $V_{Pmin}$ より高い値となるはずである.しかし,このdの領 域の DCBDV, ACBDV および ImpBDV は,図 3 に示した ように 300-350 V の範囲でそれぞれ一定の値を示し,その 値は大気中の平等電界における  $V_{Pmin}$ の値とほぼ一致する<sup>1)</sup>.



図8 電極系における  $d_0 \ge d_{Pmin}$  ( $d_0 \le d_{Pmin}$ ) Fig. 8  $d_0$  and  $d_{Pmin}$  in electrode system.

このことについては、以下のような説明が可能であろう.

図8に示すように、最短ギャップ長 $d_0$ が $d_0 < d_{Pmin}$ であっても、電極系のどこかにギャップ長が電気力線に沿った長さが $d_{Pmin}$ の距離となる箇所が必ず存在するはずである。印加電圧を0Vから一定の上昇率で図8に示す電極間に印加すると仮定した場合、そしてTownsend型の絶縁破壊が生じると仮定すると、印加電圧が $V_{Pmin}$ に達したときに絶縁破壊が図中の破線の経路で生じるはずである。つまり、 $d < d_{Pmin}$ の距離になる箇所がどこかの存在するはずであり、BDVはdの値にかかわらず、図3に示したように $V_{Pmin}$ となるはずである。別の見方をすると、少なくても $0.5 \mu m \le d \le 3 \mu m$ の領域では、電極の材料や構成を工夫することによって、印加電圧の波形を問わず、BDVを $V_{Pmin}$ に近い値に維持することができることを図3は示している。

# 4. まとめ

ギャップ長 (d) が  $0.5 \mu m \le d \le 20 \mu m$  の範囲の大気中の 絶縁破壊特性について,印加電圧波形と電極材質とを変化 させながら検討を行った.本研究で得られた事項を以下に 整理して示す.

- (1) 刃型-平板電極において, Fe 製の刃型電極とAu 蒸着 HDD 板の平板電極を用いた場合, 0.5 µm ≤ d ≤ 3 µm における DCBDV は, d の変化に関わらず, 約 330 V 一定の値となる. ACBDV と ImpBDV も DCBDV と同様の傾向を示し, この d の領域では d の変化に関わらず一定の値となる. DCBDV および ImpBDV は刃型電極へ負電圧を印加した場合の方 がやや低いが, 印加電圧極性依存性は顕著には観測 されない.
- (2) 平板電極を Au 蒸着 PMMA 板に替えて DCBDV を 測定すると, 0.5 µm ≤ d ≤ 3 µm における DCBDV は d の減少にともなって減少する.しかし,この電極 を用いた ImpBDV は, Au 蒸着 HDD 板の平板電極 を用いた場合と同様に, d の変化に関わらず約 330 V 一定の値となる.
- (3) 0.5 µm ≤ d ≤ 3 µm における BDV が d の変化に関わらず一定の値となる場合,印加電圧の上昇にともなって,電極からの電子の電界放出に基づく電流がギャップ中を流れるが,最終的には Townsend 型放電機構によって絶縁破壊が発生している.
- (4) Au 蒸着 PMMA 板を平板電極として用いた場合, 0.5 µm ≤ d ≤ 3 µm における DCBDV が d の減少にとも なって減少する場合は, 電極からの電子の電界放出

に基づく電流による Au の溶融・蒸発がトリガとなって絶縁破壊が生じる. ImpBDV では,電圧印加時間が DCBDV 測定時と比較して極めて短いので,電極の温度が上昇しないので, Field emission 型の絶縁破壊機構は発生しにくい.

# 参考文献

- 1) 静電気学会編:静電気ハンドブック, p.1129, オーム社 (1998)
- 2) 静電気学会編:静電気ハンドブック, p.1124, オーム社 (1998)
- R.M. Schaffert: Charge transport mechanisms in the transfer of latent electrostatic images to dielectric surfaces. IBM J. Res. Dev., 6,2 (1962) 192
- R.H. Fowler and L. Nordheim: Electron Emission in Intense Electric Fields. Proc. R. Soc. Lond., 119 (1928) 173
- P.G.Slade and E.D.Taylor: Electrical breakdown in atmospheric air between closely spaced (0.2 μm-40 μm) electrical contacts. IEEE Trans. Comp. Packag. Technol., 25 (2002) 390
- P. Osmokrovic, I. Krivokapic and S. Krstic.: Mechanism of electrical breakdown left of the Paschen's minimum. IEEE Trans. Dielectr. Insul. Mater., 1 (1994) 77
- J.M. Torres and R.S. Dhariwal: Electric field breakdown at micrometre separations in air and vacuum. Microsyst. Technol., 6 (1999) 6
- J. Ching-Heng, Y. Andrew and P.-J. Wang: Electrical breakdown phenomena for devices with micron separations. J. Micromech. Microeng., 16 (2006) 1366
- T. Ono, D. Y. Sim and M. Esashi: Micro-discharge and electric breakdown in a micro-gap. J. Micromech. Microeng, 10 (2000) 445
- R.S. Dhariwal, J.M. Torres and M.P.Y. Desmulliez : Electric field breakdown at micrometre separations in air and nitrogen at atmospheric pressure. IEEE Proc. Sci. Meas. Technol., 147 (2000) 261
- J. Schramm and K. Witter: Gas discharges in very small gaps in relation to electrography. Appl. Phys., 1 (1973) 331
- 12) F.W. Strong, J.L. Skinner, A.A. Talin, P.M. Dentinger and N.C. Tien: Electrical discharge across micrometer-scale gaps for planar MEMS structures in air at atmospheric pressure. J. Micromech. Microeng., 18 (2008) 075025
- P. Carazzetti, Ph. Renaud and H. R. Shea: Experimental study of electrical breakdown in MEMS devices with micrometer scale gaps. Proc. of SPIE, 6884 (2008) 688404
- 14) IEC 60243-3 (2001-7)
- H. Prinz: 電界計算法, 增田閃一, 河野照哉訳, 朝倉書 店 (1975)
- J.M. Meek and J.D. Craggs: Electrical Breakdown of Gasses, Chapter 2. John Wiley & Sons, NewYork. (1978)